Cyclomethicone/Silicone surfactant/Water Emulsion System의 Viscoelasticity

<u>최민형</u>, 강현섭, 장윤호 인하대학교 화학공학과

Viscoelasticity of the emulsion system for a cyclomethicone/silicone surfactant/water system

Min-Hyung Choi, Hyun-Seop Kang, Yoon-Ho Chang School of Chemical Engineering, Inha University

<u>1. 서론</u>

실리콘 오일은 내열성, 내 약품성, 전기 절연성, 이형성 등이 우수한 물리, 화학적 특성 때문에 여러 산업 분야에서 유용하게 사용되고 있다. 특히 전연성, 발수성, 소포성과 부드러운 감촉을 가지고 있어 화장품분야에 넓게 사용되고 있다. 그러나 실리콘오일은 낮 은 표면장력을 가지고 있어 유화과정에서 안정성을 저하시킬 수 있다. 그래서 이를 개선 하는 방법을 찾고자 Cyclomethicone과 Water의 표면장력과 계면장력을 측정하고, 비이 온 실리콘계 계면활성제를 사용하여 여러 물리적 특성값들이 어떻게 변화하는지를 알아 보았다. Cyclomethicone-water-surfactant계에서의 Emulsion을 만들고 안전성을 분석하 기 위하여 현미경을 이용하여 입자분포와 Morphology 그리고 Rheometer를 이용하여 각 각의 조성에 따른 Emulsion의 유변학적 특성들을 살펴 보았다.

<u>2. 실험</u>

2-1. Sample preparation

Decamethylcyclopentasiloxane[Cyclomethicone, KF995, Shinetusu]과 비이온 실리콘계 계면 활성제(Cetyl PEG/PPG 10/1 Demethicone[Cetyl Demethicone Copolyol, ABIL EM90, Goldschmidt])를 상온에서 교반하여 Oil Solution을 제조 하였다. 그리고 Homomixer[T.K. Homomixer MARK II]를 이용하여 2000rpm으로 교반하면서 이온교환수지를 통과한 H₂O를 Oil soilution에 lMicro tube pump[WHEATON MP-3]을 사용하여 5.2 ml/min 속도로 50분간 주입한 후, 10분더 2000rpm으로 교반하여 Stock Emulsion(water vol 80%)을 제조하였다. 제 조된 Stock emulsion을 분취하여 Homomixer(rpm 1000)를 사용하여 vol 70% vol 60%으로 dilution을 하였다[1]. 사용된 Decamethylcyclopentasiloxane 와 계면활성제의 Critical Micelle Concentration(CMC) 그리고 Physical properties을 Table 1.과 Fig 1.에 나타내었다. 본 실험에 서는 분산상인 Water의 부피변화와 계면활성제의 농도에 따른 입자 분포 및 유변학적 특성치 들의 변화를 알아보았다.

2-2. Measurement

제조된 emulsion의 Morphology와 입자 분포를 측정하기 위해 현미경 (OLYMPUS, Japan), Digital camera (Polaroid, USA)를 사용하였다. 평균입자는 Emulsion의 연속상과 같 은농도의 용액을 사용하여 dilution 하여 SimplelPCIp를 사용하여 측정 하였다[2]. 유변학적 특성 조사는 STESS TECH Rheometer (Reologica Instrument AB CO. Sweden)을 사용하였으 며, Cone diameter가 40mm이고 Cone angle이 4°인 Cone-and-Plate geometry와 Diameter가 25mm인 Bob and Cup geometry를 사용하였으며, 이때 Thermostatic bath를 사용하여 25℃ 를 유지 하여 측정하였다. 각각의 Sample들은 계면활성제의 농도변화, 분산상의 부피변화 에 따라서 viscosity, oscillation stress sweep((0.1 Hz)에 의한 linear viscoelasticity 영역판단, 그리고 viscoelasticity를 측정하기 위하여 Dynamic(oscillation) Test, Creep Recovery등을 수 행 하였다.



surface tension (mN/m)	specific gravity	viscosity (cSt)
17.8	0.956	4.0

Fig1. The CMC of cyclomethicone/ silicone surfactant system

Table 1. The physical properties of cyclomethicone

<u>3. 결과</u>

3-1. Microscope observation

제조된 각각의 Sample을 현미경으로 확인한 결과를 Fig 2. 와 Fig 3에 나타내었 다. 계면활성제의 농도가 증가할수록 입자 Size는 작아지는 것을 볼 수 있었다.



Fig 2. Optical microphotographs of water in oil emulsion (a)Water80% surf.0.5%, (b)water80% surf.2.5%, (c)water70% surf.0.5%, (d)water70% surf.2.5%.



Fig 3. Variation of Particle size with surfactant concentrations (wt/vol%)

3-2. Rheological Analysis

Fig 4.에서 계면활성제의 농도가 증가함에 따라 Viscosity가 증가함을 보였다. 분산 상이 vol 80%인 경우 Emulsion은 Non-Newtonian 거동을 보이며, 계면활성제 농도에 따라 0.5 wt %보다 1.0 ~ 3.0 wt %에서 강한 Shear thinning 현상을 Shear Stress 5-10 Pa에서 볼 수 있었다.[3] 그리고 Fig 5. 에서는 같은 계면활성제의 농도에서 분산상의 vol% 변화에 따라 viscosity를 표현하였다. 분산상의 부피가 증가할수록 Non-Newtonian 거동을 보이며, viscosty가 증가함을 알 수 있었다. 분산상의 함량이 70%인 경우 계면활성제의 농도가 0.5% ~ 1.5%와 같이 비교적 낮았을 때 complex modulus는 Frequency(Hz)가 증가하면서 일정한 기울기를 가지고 증가하는 경향을 나타내나 2.0 wt % ~ 3.0 wt에서는 frequency에 대한 영향이 상대적으로 적게 나타남을 Fig. 6.에서 볼 수 있다.[4]



Fig 4. Vicosity as a function of shear stress for 80% water content emulsions



Fig 5. Vicosity as a function of shear stress for different water contents emulsions



Fig 6. G* as a function of frequency for 70% water content emulsions

Fig. 7. 과 Fig 8.에 의하면 shear stress는 낮은 영역(3 ~5 Pa) 그리고 분산상의 Vol fraction이 높은 영역(80 %)에서 Emulsion의 viscoelasticity를 확인할 수 있다.[5]



Fig 7. The effect of shear stress on the creep/recovery behavior of highly concentrated emulsion (surf. 1.5 wt/vol%, water 80vol%)



Fig 8. The effect of volum fraction on creep/recovery behavior of emulsion (surf. 1.5 wt/vol %, stress 5 Pa)

<u> 참고문헌</u>

- 1. Yasufuni Otsubo, Robert K. Prud'Homme., J. Soc Rheol Japan, 20, 125(1992)
- 2. Yasufuni Otsubo, Robert K. Prud'Homme., Rheologica Acta, 33, 29(1994)
- 3. Rajinder Pal., J. Colloid Interface sci., 225. 359(2000)
- 4. Rajinder Pal., J. Colloid Interface sci., 232. 50(2000)
- 5. Peterr Holmqvist, Christophe Daniel, Ian W. Hamley, Withawat Mingvanish, Ccolin Booth., colloidd Sufaces A., **196**, 39(2002)